

低雜訊高電阻溫度係數鑭鈣錳氧塊材之傳輸特性研究

陳信偉、王立民；李得勝

E-mail: 9806482@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究論文在探討以固態燒結法製作 $\text{La}_{0.75}\text{Ca}_{0.25-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ 系列塊材($x=0, 0.05, 0.08, 0.1, 0.15, 0.2$)。我們研究Sr在不同摻雜比例之下，其電阻-溫度係數(Temperature Coefficient of Resistance, TCR)，及金屬-絕緣轉換溫度(Metal-insulator Transition Temperature, TP)之性質。我們發現當 x 愈大(Sr摻雜比例愈高)，其TP愈大，且其最大TCR值(TCRMAX)則呈現越小的趨勢。且我們對於 $\text{La}_{0.75}\text{Ca}_{0.15}\text{Sr}_{0.1}\text{MnO}_3$ 之樣品來討論，研究在不同通氣退火條件下(900~1050)對其O/Mn原子的比例、TCRMAX及金屬-絕緣轉換溫度(TP)之影響。我們發現在通氣退火1000 下有其最大TCR值，TCRMAX由未退火前的6.45%/K提升至9.81%/K，TP也由未退火前的299 K提高為316 K，其O/Mn原子的比例約為4.1左右。

其次，我們利用載子密度崩潰(current-carries-density-collapse)模型，推導出TCRMAX與雙極化子結合能(bipolaron binding energy, E_b)的關係，可以預期，當 E_b 越低時，其TCRMAX值則會越高。

最後，利用本實驗室自製之低雜訊放大器，來量測樣品的熱雜訊，我們發現其雜訊值低於 $1.2 \times 10^{-9} \text{ V Hz}^{-0.5}$ 以下。

關鍵詞：紅外線偵測器、電阻溫度係數、金屬-絕緣轉換溫度、載子崩潰模型、雙極化子、熱雜訊

目錄

封面內頁	
簽名頁	
授權書	iii
中文摘要	iv
英文摘要	v
誌謝	vi
目錄	vii
圖目錄	x
表目錄	xv

第一章 序論

1.1 紅外線偵測器原理及其應用	1
1.2 具高TCR之含錳氧化物材料研究發展現況	3
1.3 超巨磁阻材料簡介	4
1.3.1 CMR材料 - 改變摻雜比例之介紹	6
1.3.2 CMR材料 - 通氣退火之介紹	10
1.4 研究目的及方法	14

第二章 理論基礎

2.1 物質的磁性	15
2.1.1 磁性原理簡介	15
2.1.2 磁阻介紹	18
2.1.3 超巨磁阻材料—鈣鈦礦錳氧化物之結構	19
2.1.4 雙交換理論	20
2.1.5 Jahn-Teller distortion	22
2.1.6 $\text{La}_{1-x}\text{A MnO}_3$ ($\text{A} = \text{Ca, Sr, Ba}$) 之物理特性	22
2.1.7 LaAMnO_3 之電傳導特性	23
2.2 CMR材料之電阻傳輸機制	24
2.2.1 極化子之傳輸機制	24
2.2.2 輽子崩潰模型	25
2.3 雜訊理論	28
2.4 TCR與雜訊對熱輻射偵測器靈敏度之影響	31

第三章 實驗方法與儀器設備

3.1樣品的製備	32
3.1.1固態燒結法	32
3.1.2實驗流程敘述	32
3.2實驗儀器	37
3.2.1高溫電性實驗爐	37
3.2.2高溫爐管	38
3.2.3研磨拋光機	40
3.2.4 X-ray繞射分析儀	41
3.2.5掃描式電子顯微鏡(SEM)	43
3.2.6成分分析儀(EDS)	44
3.2.7電阻率量測	45
3.2.8磁化強度之量測	48

第四章 結果與討論

4.1樣品結構與成分分析	49
4.1.1 X-ray繞射分析	49
4.1.2掃描式電子顯微鏡分析(SEM)	52
4.1.3能量散佈X-ray光譜分析(EDS)	53
4.2不同Sr摻雜比例(x)之電阻溫度係數(TCR)分析	55
4.3不同外加磁場下之電阻溫度係數(TCR)分析	59
4.4磁化強度與居禮溫度之關係	64
4.5通氧退火之效應	70
4.5.1不同通氧退火溫度之掃描式電子顯微鏡(SEM) 分析	71
4.5.2不同退火溫度之成分分析	72
4.5.3不同退火溫度之X-ray繞射分析	73
4.5.4不同退火溫度之電阻溫度係數(TCR)分析	75
4.5.5合不同通氧退火溫度下，TCRMAX與TP (TCRMAX)之關係	79
4.6雙極化子結合能(-1)對TCR值影響之討論	80
4.7雜訊之量測	88
第五章 結論	91
參考文獻	93

參考文獻

- [1]鐘富昭, 8501/8502 系列應用設計. 全華科技[2]盧正興、陳昭綾, 單晶片微電腦應用. 高立圖書[3]李鴻鵬, 8051/8051 原理與應用. 全華科技[4]盧明智、盧鵬任, 感測器應用與線路分析. 全華科技[5]G.Urban, A. Tachimovicz, F. Kohl, H. Kuttner, F. Olcaytug ,and H. Kamper, Sensors and Actuators ,A21, p.650 (1992)[6] A. Lisauskas, S. I. Khartsev, and A. Grishin , Appl. Phys. Lett. 77, 3302 (2000)[7] C. M. Travers, A. Jahanzeb, D. P. Butler, and Z. ?elik-Butler, J. Microelectromech. Syst. 6, 271 (1997)[8] A. P. Gruzdeva, V. Y. Zerov, O. P. Konovalova, Y. V. Kulikov, V. G. Malyarov, I. A. Khreblov, and I. I.
- [9] C. Marshall, N. Butler, R. Blackwell, R. Murphy, and T. Breen, Proc. SPIE 2746, 23 (1996).
- [10] K. Chahara, T. Ohno, M. Kasai, and Y. Kozono, Appl. Phys. Lett. 63, 1990 (1993)[11] R. von Helmholz, J. Weckerg, B. Holzapfel, L. Schultz, and K. Samwer, Phys. Rev. Lett. 71, 2331 (1993).
- [12] S. Jin, T. H. Tiefel, M. McCormack, R. A. Fastnacht, R. Ramesh, and L. H. Chen, Science 264, 413 (1994).
- [13] R. Shreekala, M. Rajeswari, S. P. Pai, S. E. Lofland, V. Smolyaninova, K. Ghosh, S. B. Ogale, S. M. Bhagat, M. J. Downes, R. L. Greene, R. Ramesh, and T. Venkatesan, Appl. Phys. Lett. 74, 2857 (1999).
- [14] A. Goyal, M. Rajeswari, C. Kwon, R. Ramesh, T, Venlatesan, R. Shreekala, S. E. Lofland, S. M. Bhagat, Appl. Phys. Lett. 71, 2535 (1997).
- [15] A. Barman and G. Koren, Appl. Phys. Lett. 77, 1674 (2000).
- [16] A. Lisauskas, S. I. Khartsev, and A. Grishin , Appl. Phys. Lett. 77, 756 (2000)[17] S. Y. Wu, W. -H. Li, K. C. Lee, T. H. Meen, and H. D. Yang, 79, 6571 (1996)[18] W. -H. Li, Y. F. Lin, S. Y. Wu, K. C. Lee, J. W. Lynn, and H. C. Ku Journal of Appl Phys, 79 , 6568 (1996)[19] W. -H. Li, W. Y. Chuang, S. Y. Wu, and K. C. Lee Japan Joint Seminar on Crystallography, 65 (1996)[20] W. -H. Li, S. Y. Wu, K. C. Lee, J. W. Lynn, R. S. Liu, J. B. Wu, and C. Y. Huang, Journal of Applied Physics, 85, 5588 (1999)[21] L. M. Wang, H. C. Yang, and H. E. Horng , Phys. Rev B 64, 224423 (2001)[22] P. R. Broussard, S. B. Qadri, V. M. Browning, and V. C. Cestone, Appl. Phys. Lett. 71, 2535 (1997)[23] Alvydas Lisauskas, S. I. Khartsev, and Alex Grishina, Appl. Phys. Lett. 77, 5 (2000)[24] Y. Tomioka, A. Asamitsu and, Y. Tokura, Phys. Rev B. 63, 024421 (2000)[25] A.

Goyal, M. Rajeswari, R. Shreekala, S. E. Lofland, S. M. Bhagat, T. Boettcher, C. Kwon, R. Ramesh, and T. Venkatesan, Appl. Phys. Lett. 71, 27 (1997)[26] M. Rajeswari, R. Shreekala, A. Goyal, S. E. Lofland, S. M. Bhagat, K. Ghosh, R. P. Sharma, R. L. Greene, R. Ramesh, and T. Venkatesan, Appl. Phys. Lett. 73, 18 (1998)[27] Whiley, "Soshin Chikazumi, Physics of Ferromagnetism", 1964, p. 3.

[28] B. D. Cullity, "Introduction to Magnetic Materials", 1972, p. 85. (Addison-Wesley, Massachusetts)[29] Robert C. O. Handley, Modern Magnetic Materials Principles and Applications (John Wiley & Sons, New York, 2000)[30] J. Baszynski, T. Tolinski, B. Idzikowski, D.M. Tobbens, A. Hoser J. Baszynski et al. / Journal of Alloys and Compounds 345 (2002) 210[31] C. Zener, Phys. Rev. 81, 440 (1951)[32] C. Zener, Phys. Rev. 82 403(1951)[33] P. Schiffer, A. P. Ramirez, W. Bao and S.-W. Cheong, Phys. Rev. Lett. 75, 3336 (1995)[34] A. Urushibara, Y. Moritomo, T. Arima, A. Asamitsu, G. Kido and, Y. Tokura, Phys. Rev. B. 51, 14103 (1995)[35] A. S. and A. M. Bratkovsky, Phys. Rev. Lett. 82, 141 (1999)[36] Guo-meng Zhao, V. Smolyaninova, W. Prellier, and H. Keller, Phys. Rev. Lett. 84, 6086 (2000)[37] G. J. Snyder, R. Hiskes, S. DiCarolis, M. R. Beasley, and T. H. Ge, Phys. Rev. B 53, 14 434 (1996).

[38] T. Akimoto, Y. Moritomo, and A. Nakamura, Phys. Rev. Lett. 85, 3914 (2000)[39] L. M?chin, F. Yang, J.-M. Routoure, and D. Robbes, J. Appl. Phys. Lett. 93, 8062 (2003)[40] A. Lisauskas, S. I. Khartsev, and A. Grishin, Appl. Phys. Lett. 77, 756 (2000)[41] C. Marshall, N. Butler, R. Blackwell, R. Murphy, and T. Breen, Proc. SPIE 2746, 23 (1996)[42] Tong Li, Bo Wang, Hongyun Dai, Yongsheng Du, and Hui Yan, J. Appl. Phys. 98, 123505 (2005)[43] Fan Yang, Li, Laurence Mechin, Jean-Marc Rautoure, Bruno Guillet, and Radoslav A. Chakalov, J. Appl. Phys. 99, 024903 (2006)[44] 大葉大學, 吳智淵, 95年碩士論文[45] 大葉大學, 白順昌, 98年碩士論文